

設計製造等の機器使用基本利用料金表（2023年4月1日～）

設置場所	用途	装置番号と装置名	仕様	型番	メーカー	学内利用者料金	学外利用者料金	備考		
(1F) プロセス室	イオン注入	1	イオン注入装置	リンおよびホウ素のイオン注入	IMX-3500	ULVAC	2,000円/時間	4,000円/時間		
	成膜	2	減圧CVD装置	poly-Si堆積	272-M200	光洋リンドバーグ	2,000円/時間	4,000円/時間		
		3	PE-CVD装置	SiO ₂ , SiN, a-Siの堆積	PD-200NL	サムコ	2,000円/時間	4,000円/時間		
		5	スパッタ装置2	各種金属膜の堆積 2inchターゲット φ4inch以下の基板対応	E-200S	キヤノンアネルバ	2,000円/時間	4,000円/時間		
	酸化 拡散 熱処理	7	電気炉1号炉	ドライ酸化用 Siウエーハのみ	M200, M300	光洋リンドバーグ	2,000円/時間	4,000円/時間		
		8	電気炉2号炉	ドライおよびウェット酸化用 Siウエーハのみ	M200, M300	光洋リンドバーグ	2,000円/時間	4,000円/時間		
		9	電気炉3号炉	シンタリング用 金属はAl限定	M200, M300	光洋リンドバーグ	2,000円/時間	4,000円/時間		
		10	電気炉4号炉	拡散用 Siウエーハのみ	M200, M300	光洋リンドバーグ	2,000円/時間	4,000円/時間		
		11	電気炉5号炉	材料限定無し	M200, M300	光洋リンドバーグ	2,000円/時間	4,000円/時間		
		12	縦型拡散炉	ゲート酸化膜作製用	V4-25LL	ULVAC	2,000円/時間	4,000円/時間		
		13	高速熱処理炉1	極薄酸化膜形成用 φ4inch基板対応	RTP-6	ULVAC	2,000円/時間	4,000円/時間		
	エッチング	15	Si系材料 ドライエッチング装置	Si, SiO ₂ , SiNのエッチング	RIE-101iPH (フッ素ガス仕様)	サムコ	2,000円/時間	4,000円/時間		
		16	Metal系材料 ドライエッチング装置	上記以外材料のエッチング	RIE-101iPH (塩素ガス仕様)	サムコ	2,000円/時間	4,000円/時間		
	(1) フォト室	描画	18	電子線描画装置	4inchおよび5inch角フォトマスク, φ4inchSiウエーハ対応	JBX-6300	JEOL	2,000円/時間	4,000円/時間	
		露光	19	縮小投影露光装置	i線露光 φ4inchSiウエーハおよび 35mm角基板対応	FPA-3000i5+	キヤノン	2,000円/時間	4,000円/時間	
			20	両面マスクアライナー	g線露光 4inchおよび5inch角フォトマスク, φ4inch以下試料対応	MA-6	ズースマイクロテック	2,000円/時間	4,000円/時間	
(1F) プロセス室	薬品洗浄 エッチング	22	無機ドラフトチャンバー(HF)	HF, BHF洗浄	HSS-2000HF	ダン産業	1,250円/時間	2,500円/時間		
		23	無機ドラフトチャンバー(-般酸)	HF, BHF以外の洗浄およびエッチング	HSS-2000HF	ダン産業	1,250円/時間	2,500円/時間		
		24	RCA洗浄槽	RCA洗浄(Siのみ) ピラニア洗浄(Si, フォトマスクのみ)		ダルトン	1,250円/時間	2,500円/時間		
	レジスト除去	25	アッシャー1	レジスト除去	RP-510	ヤマト科学	1,250円/時間	2,500円/時間		
	ウエハ乾燥	26	スピンドライヤー	Siウエーハの乾燥 φ4inchウエーハカセット専用	SPD160RN	コクサン	1,250円/時間	2,500円/時間		
(1F) 材料作製室	観察	27	光学顕微鏡1	各プロセスにおけるウエーハ確認	OPTIPHOTO-200	ニコン	500円/時間	1,000円/時間		
(1F) フォト室	レジスト塗布	28	スピコーター1	i線レジスト塗布 EBレジスト塗布	DELTA80	ズースマイクロテック	1,250円/時間	2,500円/時間		
		29	スピコーター2	TSMR, OMR塗布	IH-DX2	ミカサ	1,250円/時間	2,500円/時間		
	ベーク	30	クリーンオープン	EBレジスト乾燥	DE410	ヤマト科学	1,250円/時間	2,500円/時間		
		31	ホットプレート1	フォトレジスト乾燥	MH-180	井内	1,250円/時間	2,500円/時間		
		32	ホットプレート2	フォトレジスト乾燥	MH-180CS	アズワン	1,250円/時間	2,500円/時間		
	33	有機ドラフトチャンバー1	現像, 有機薬剤による洗浄	HSS-2000	UNION	1,250円/時間	2,500円/時間			
(1F) プロセス室	観察 寸法測定	34	DUV顕微鏡	ウエーハ上, マスク上パターンの確認 5ミクロン以下のパターン観察	INM300 DUV	KLA-Tencor	1,250円/時間	2,500円/時間		
(1F) フォト室		35	光学顕微鏡2	測長顕微鏡 ウエーハ上, マスク上パターンの確認 5ミクロン以上のパターン観察	エクリプスL200AF	NIKON	1,250円/時間	2,500円/時間		
	薬品洗浄 エッチング	36	有機ドラフトチャンバー2	有機薬品専用			1,250円/時間	2,500円/時間		
		37	無機ドラフトチャンバー1	無機薬品専用			1,250円/時間	2,500円/時間		
	成膜	38	蒸着装置1	金属膜堆積	E-250	島津製作所	1,250円/時間	2,500円/時間		
		39	蒸着装置2	金属膜堆積	VPC-260	ULVAC	1,250円/時間	2,500円/時間		

(1F) 材料作製 室	酸化・拡散	40	電気炉	熱処理、酸化、拡散用	55453	光洋リンドバーグ	1,250円/時間	2,500円/時間		
	レジスト塗布	41	スピナー3	フォトレジスト塗布	IH-DX2	ミカサ	1,250円/時間	2,500円/時間		
	ベーク	43	ホットプレート3	フォトレジスト乾燥	8017P-1	IUCHI SEI EIDO	1,250円/時間	2,500円/時間		
		44	ホットプレート4	熱処理	CTH	アズワン	1,250円/時間	2,500円/時間		
	露光	45	マスクライナー1	フォトレジストパターンニング	PEM-1000	ユニオン光学	1,250円/時間	2,500円/時間		
		46	マスクライナー2	フォトレジストパターンニング	K310P160S	共和理研	1,250円/時間	2,500円/時間		
	薬品実験	49	有機ドラフトチャンバー	有機薬品専用			1,250円/時間	2,500円/時間		
		50	無機ドラフトチャンバー	無機薬品専用			1,250円/時間	2,500円/時間		
	(2F) マイクロ化 技術室	チップの接合	52	接合装置	陽極接合、加熱加圧接合	KOG-404-V改	PMT	1,250円/時間	2,500円/時間	
		ガラス機械加工	53	ガラス加工装置	ガラス、Siなど脆性材料の機械加工	DBM-100-S1	PMT	1,250円/時間	2,500円/時間	
切断		54	ダイサー+マウンター	ウェーハダイシング	DAD322	DISCO	1,250円/時間	2,500円/時間		
表面・断面観察		55	簡易SEM	表面・断面観察 φ6inchまで対応可能	JCM-5700	日本電子	1,250円/時間	2,500円/時間		
		56	実体顕微鏡1	表面観察	SMZ1000	ニコン	500円/時間	1,000円/時間		
(2F) 状態評価 室		表面・断面観察	57	FIB/SEM複合装置	加工、表面・断面観察	JIB-4600F	JEOL	1,250円/時間	2,500円/時間	
	表面観察	59	SCM/SPM装置	表面形状観察	MultiModeVS SPM System	日本ビーコ	1,250円/時間	2,500円/時間		
(2F) システム化 技術室	ワイヤー ボンダー	60	WEST-BOND	ワイヤーボンディング	7476D	ハイソル	1,250円/時間	2,500円/時間		
(2F) 設計開発 室		62	プロービングシステム	MOSTランジスター特性評価		アジエントテクノロジー +ベクターセミコン	1,250円/時間	2,500円/時間		
(2F) マイクロ化 技術室		63	高電圧カーブトレーサ +プローバー	高耐圧デバイス特性評価	CS-3300	岩通 +ベクターセミコン	1,250円/時間	2,500円/時間		
(1F) 炉体 室	抵抗測定	64	四探針測定器1	抵抗値測定、TCR測定	Model RT-70 RG -5 +TCR	ナブソン	500円/時間	1,000円/時間		
	接合強度測定	65	ダイシエータテスト装置	接合強度の評価	4000P	デジ	500円/時間	1,000円/時間		
(1F) 材料作製 室	段差測定	68	表面形状測定器1	段差測定	DEKTAK3030	SLOAN	500円/時間	1,000円/時間		
(2F) 状態 評価室	段差測定	69	表面形状測定器2	段差測定	DEKTAK3	SLOAN	500円/時間	1,000円/時間		
1F) プロセス室	成膜	73	厚膜CVD	TEOSによるSiO ₂ の堆積	PD-100ST	サムコ	2,000円/時間	4,000円/時間		
		74	ALD装置		Savannah S100-4PVP	ケンブリッジ	2,000円/時間	4,000円/時間		
	エッチング	75	高速深堀RIE	Siの深堀り	800IPB	サムコ	2,000円/時間	4,000円/時間		
		76	XeF ₂ エッチャー	Siの等方性ドライエッチング	自作	自作	2,000円/時間	4,000円/時間		
(2F) マイクロ化 技術室	洗浄	77	超臨界乾燥洗浄装置	構造倒伏防止乾燥	LSCRD403	隆祥産業	1,250円/時間	2,500円/時間		
	研磨	78	断面研磨システム	断面観察用研磨、チップ研磨	MPC2000	ビューラー	1,250円/時間	2,500円/時間		
	メッキ	79	メッキ装置	金、銅メッキ(電解、無電解メッキ対応)		北斗電工	1,250円/時間	2,500円/時間		
	塗布	80	クイックコーター	SEM観察前処理用	SC-701MK II	サンユー電子	1,250円/時間	2,500円/時間		
	熱処理	82	小型チューブ炉	有機膜熱処理用	KTF050N1	KOYO	1,250円/時間	2,500円/時間		
	信頼性評価	83	オープン	乾燥、恒温測定	DX302	Yamato	1,250円/時間	2,500円/時間		
	観察	84	光学顕微鏡	表面観察	ECLIPSE	NIKON	500円/時間	1,000円/時間		
(2F) 設計開発 室	特性評価	86	半導体パラメーターアナライザー3 +プローバー	MOSTランジスター特性評価	B1500A	Agilent +MICRONICS JAPAN	1,250円/時間	2,500円/時間		

	モデリング	88	SPICEモデル抽出ツール	SPICEパラメータ抽出	020000_020101	Silvaco	1,250円/時間	2,500円/時間	
	テスト	89	LSIテスター	LSIテスト	DRAGON	HiLevel	1,250円/時間	2,500円/時間	
(2F)設計技術室	設計	90	Synopsys社EDAツール群	論理設計・合成系 (Verilog, Design Compilerなど)	6787-0	Synopsys	500円/時間 飯塚キャンパスに限る	貸出不可	
		91	Mentor社EDAツール群	レイアウト検証系 (Calibre DRC, LVS) + 寄生値抽出	264860	Mentor	500円/時間 飯塚キャンパスに限る	貸出不可	
		92	プロセスデバイスシミュレータ	プロセスシミュレーション、デバイス特性シミュレーション	010101~010224	Silvaco	500円/時間 飯塚キャンパスに限る	貸出不可	
(1F)フォト室	描画	93	マスクレス露光装置	g, h, 露光 5mm角~125mm角試料に対応 dx.f, gdsII, cif, gerberデータ対応	MLA100	Heiderberg	2,000円/時間	4,000円/時間	
(1F)炉体室	膜厚測定	94	エリブソメーター	試料台: 6inch ビーム径: 1mmφ 測定範囲数A~6ミクロン (SiO2/Si)	LSE	ガートナ	1,250円/時間	2,500円/時間	
(1F)フォト室	描画	95	マスクレス露光装置	露光 25mm角以下の試料 分解能: 5ミクロン	PALET	ネオアーク	2,000円/時間	4,000円/時間	
(1F)炉体室	膜厚測定	96	膜厚測定器	透明薄膜の光学的膜厚測定 (非接触)	M5000	ナノスペック	1,250円/時間	2,500円/時間	
材料作製室	現像	97	有機ドラフト (イエローブース)	フォトリソ現像		Dan-Takuma	1,250円/時間	2,500円/時間	
マイクロ化技術室	表面観察	98	実体顕微鏡2	表面観察	SMZ1500	ニコン	500円/時間	1,000円/時間	
(1F)プロセス室: CR	成膜	99	スパッタ装置3	各種金属膜の堆積 2inchターゲット φ4inch以下の基板対応	EB-1000	キャノンアネルバ	2,000円/時間	4,000円/時間	
(1F)フォト室	表面観察	100	3次元光学顕微鏡	表面観察	VHX-7000	Keyence	1,250円/時間	2,500円/時間	
(2F)システム化技術室	特性評価	101	オートブローバー	MOSTランジスタ特性評価	B1500A+HSP-150	Agilent+HISOL	1,250円/時間	2,500円/時間	
(2F)マイクロ化技術室	表面観察	102	共焦点レーザー顕微鏡	表面の3次元観察 (白色干渉計搭載)	VK-X3000	キーエンス	1,250円/時間	2,500円/時間	
(2F)設計技術室	設計	103	レイアウト作成ツール	レイアウト作成	L-Edit	Tanner	1,000円/時間	2,000円/時間	

- ・学内利用者が運営費交付金で利用する場合、2年間を限度に装置利用料金は上記の1/5とする。
- ・使用可能時間は9:00~17:00とする。
- ・上記時間外での利用が生じた場合には、装置利用料金を1.5倍に加え時間外管理費用 (学内5,000円/時間、学外10,000円/時間) を徴収する。

品番	操作指導料・代理操作料	学内	学外
op	操作指導料	3,000円/時間	6,000円/時間
ops	代理操作	5,000円/時間	10,000円/時間

品番	CR内デシケータ利用料金	学内	学外
u1a	A	1600円/月	2,560円/月
u1b	B	1,000円/月	1,600円/月

品番	白衣更衣室ロッカー利用料金	学内	学外
u2	白衣更衣室ロッカー	500円/月	800円/月

品番	フォトマスク作製料金	学内 (改定後)	学外 (改定後)
998	フォトマスク作製	95,600円/枚	125,200円/枚

※装置利用料金および操作指導料、代理操作料は30分単位で切り上げし課金する。

消耗品料金			
品番	品名	単位	単価
s1	Siウエハ	1枚	¥3,440
s2	マスクブランクス (ステッパー用5インチ)	1枚	¥17,680
s3	マスクブランクス (ライナー用5インチ)	1枚	¥3,380
s4	マスクブランクス (ライナー用4インチ)	1枚	¥3,250
s5	EBレジスト (ポジ) ZEP-520	1cc	¥3,900
s6	EBレジスト (ネガ) SAL-601	1cc	¥850
s7	マスクケース	1個	¥3,900
s8	蒸着金線	10 mm	¥2,600
s9	FIB-SEM FIB Gaイオン源使用	10分	¥590
s10	FIB-SEMプラチナデポ	10分	¥780
s11	ウエハケース	1組	¥1,970
s12	FIB-SEMカーボンデポ	10分	¥120
s13	蒸着アルミ線	10 mm	¥10
s14	チップトレイ	1セット	¥2,860
s15	クリーンスーツ (M~6L)	1着	¥5,020
s16	クリーンシューズ (23.5cm~29cm)	1足	¥7,600
s17	チップ搬送ケース	1個	¥3,920
s18	再生Siウエハ	1枚	¥1,430
Au	スパッタターゲット Au	10分	¥9,610
Pt	スパッタターゲット Pt	10分	¥8,710
Ag	スパッタターゲット Ag	10分	¥300
Al	スパッタターゲット Al	10分	¥290
AIN	スパッタターゲット AIN	10分	¥500
Al2O3	スパッタターゲット Al2O3	10分	¥680
AlSi1	スパッタターゲット AlSi(1%)	10分	¥660
AlSi3	スパッタターゲット AlSi(3%)	10分	¥660

Co	スパッタターゲット Co	10分	¥1,540
Cr	スパッタターゲット Cr	10分	¥430
Cu	スパッタターゲット Cu	10分	¥90
Ge	スパッタターゲット Ge	10分	¥590
Ni	スパッタターゲット Ni	10分	¥460
Si	スパッタターゲット Si	10分	¥200
SiO2	スパッタターゲット SiO2	10分	¥450
Ta	スパッタターゲット Ta	10分	¥340
Ta2O5	スパッタターゲット Ta2O5	10分	¥930
Ti	スパッタターゲット Ti	10分	¥430
TiN	スパッタターゲット TiN	10分	¥680
TiO2	スパッタターゲット TiO2	10分	¥850
W	スパッタターゲット W	10分	¥430
RCA	RCA洗浄精薬品	1回	¥1,520
SPM	SPM洗浄精薬品	1回	¥1,900
BHF	BHF洗浄精薬品	1回	¥1,600
XeF2	XeF2ガス	1回	¥390
J1	1.イオン注入装置除害剤	10分	¥60
J2	2.減圧CVD装置除害剤	10分	¥70
J3	3.PE-CVD装置除害剤	10分	¥180
J15	15.Si系材料ドライエッチング装置除害剤	10分	¥90
J16	16.Metal系材料ドライエッチング装置除害剤	10分	¥90
J73	73.厚膜CVD除害剤	10分	¥170
J75	75.高速深堀RIE除害剤	10分	¥200

※その他の消耗品費は、別途請求する